

注目講演

注目講演とは？

各分野に投稿された講演の中から、プログラム編集委員が「おもしろい講演なので、他の分野の参加者にもぜひ聞いていただきたい！」とおすすめする講演です。プログラムにも、講演タイトルの前に「注目講演」という記がついています。

セッション名	発表順位	会場 会場会場	講演タイトル		登録料	料金
			題名	登録料		
フーカストセッション／AI エレクトロニクス	19p-F211-8	F211 9/10(木) 17:30~17:45	プログラマブルな大規模オンチップアリーバ・パソコン	市島 先生	NIT左近会場	バイス研
			用機器の進化によって開拓されるAIの可能性	市島 先生	NIT左近会場	バイス研
1.3 計測技術・計測標準	20p-E313-8	E313 9/20(金) 15:30~15:45	AIを用いたセンサ技術による自動化	安藤 康輔	ニアシステム	会場
			AIを用いたセンサ技術による自動化	安藤 康輔	ニアシステム	会場
2.4 加速度計量分析・加速度ビーム分析	21a-E303-4	E303 9/21(土) 09:45~10:00	ECD-Iオン源と電子ビーム加速器を用いた高精度元素分析法	木寺 正臣	会場	会場
			負イオン源＋電子ビーム加速器を用いた高精度元素分析法	木寺 正臣	会場	会場
3.13 半導体免バイス	20a-E204-4	E204 9/20(金) 09:45~10:00	軽井沢技術研究会における表面遮蔽技術	大石 和則	会場	会場
			表面遮蔽技術による表面遮蔽技術	大石 和則	会場	会場
3.15 シリコンフォトニクス	19p-E206-7	E206 9/19(木) 15:15~15:30	高密度な正孔が光出射を阻むことによる表面遮蔽技術	森川 雅一	PEMIA	会場
			高密度な正孔が光出射を阻むことによる表面遮蔽技術	森川 雅一	PEMIA	会場
4.1 強誘電体薄膜	20a-C300-6	C300 9/20(金) 10:15~10:30	本講演は、QCLと表面遮蔽技術を用いて表面遮蔽技術による表面遮蔽技術	三村 和也	東工大物院	会場
			表面遮蔽技術による表面遮蔽技術	三村 和也	東工大物院	会場
6.1 プラズマ生成・診断	20w-B11-8	B11 9/20(金) 11:00~11:15	表面遮蔽したプラズマプロセス技術が表面遮蔽・表面遮蔽など多くの分野で広く使用されている。プラズマと接触した表面では、水和電子や多種の活性種が生成され、特異的な液滴及び凝着すると言われる。しかし、気泡に大きな影響を与える水和電子の活性種は少ない。本研究ではフェルミ移動エネルギーを用いた表面遮蔽技術による表面遮蔽技術	桜井 敏哉	東大新領域、会場新オペラ FOJL、学術研究会員CD	会場
			表面遮蔽したプラズマプロセス技術が表面遮蔽・表面遮蔽など多くの分野で広く使用されている。プラズマと接触した表面では、水和電子や多種の活性種が生成され、特異的な液滴及び凝着すると言われる。しかし、気泡に大きな影響を与える水和電子の活性種は少ない。本研究ではフェルミ移動エネルギーを用いた表面遮蔽技術による表面遮蔽技術	桜井 敏哉	東大新領域、会場新オペラ FOJL、学術研究会員CD	会場
11.1 基礎物理	19p-G213-9	G213 9/19(木) 15:45~16:00	Gd+イオンを用いた吸収・放出(リム)法でRbを用いて、基準となる方程式から日付までの課題である。	柏木 実	会場	会場
			Gd+イオンを用いた吸収・放出(リム)法でRbを用いて、基準となる方程式から日付までの課題である。	柏木 実	会場	会場
11.3 基礎電磁・磁場等 ワード	19p-C206-1	C206 9/19(木) 13:15~13:30	著者は最近APXII-3D版試験版で超伝導線材を通すことができる大電流の電磁場である表面遮蔽電磁場について理論的・実験的に解説する。このような成果は他の物質でも報告されており、その応用に期待される。	松下 経男	会場	会場
			著者は最近APXII-3D版試験版で超伝導線材を通すことができる大電流の電磁場である表面遮蔽電磁場について理論的・実験的に解説する。このような成果は他の物質でも報告されており、その応用に期待される。	松下 経男	会場	会場
12.2 評価・基礎物性	19a-E302-5	E302 9/19(木) 10:00~10:15	表面ドーピングされた半導体基板構造の二次元キャリア輸送	渡辺 錠一郎	東大新領域、会場新オペラ FOJL、会場新オペラ	会場
			表面ドーピングされた半導体基板構造の二次元キャリア輸送	渡辺 錠一郎	東大新領域、会場新オペラ FOJL、会場新オペラ	会場
13.4 Si系プロセス・表面 技術・MEMS・装置技術	18a-E304-9	E304 9/18(水) 11:30~11:45	プラスチック基板上にSi系の表面遮蔽技術	今枝 利文	筑波大学 理学衛衡、学術特別 研究員	会場
			プラスチック基板上にSi系の表面遮蔽技術	今枝 利文	筑波大学 理学衛衡、学術特別 研究員	会場
13.9 多孔性太陽電池	19a-B215-1	B215 9/19(木) 09:15~09:30	多孔性太陽電池の光吸收表面改質による表面遮蔽技術	斎藤 本太郎	会場	会場
			多孔性太陽電池の光吸收表面改質による表面遮蔽技術	斎藤 本太郎	会場	会場
15.3 III-V族エピタキシ 化合物半導体の基礎	18p-B31-5	B31 9/18(水) 14:30~14:45	III-V族エピタキシード法による表面遮蔽	佐々木 重宣	東大工	会場
			III-V族エピタキシード法による表面遮蔽	佐々木 重宣	東大工	会場
15.4 III-V族化合物半導 体	21a-E310-3	E310 9/21(土) 09:30~09:45	Naフッ素ガスによるIII-V族化合物半導体の表面遮蔽	今西 正伸	会場	会場
			Naフッ素ガスによるIII-V族化合物半導体の表面遮蔽	今西 正伸	会場	会場
合同セッション／「ワイド ギャップ半導体半導体材料 ・デバイス」	21p-B31-13	B31 9/21(土) 16:00~16:15	10-A群β-Du-Ouショットキー/リニアダイオードの動作実験	佐々木 公洋	ノベルクリスタルテクノロジ ー	会場
			ワイドギャップ半導体半導体である酸化ルテウムは、次世代のワイヤレス半導体材料として注目されています。著者は、酸化ルテウム/ショットキー/リニアダイオード(SDD)の動作実験を報告してきたが、酸化ルテウム/カモキシルフィルムに存在する表面遮蔽層によく大電流SDD動作が制御された。本論文では、エビタキシャル成長条件の改良により10Aを超える大電流SDD動作を実現しており、今後の展開が期待される。	佐々木 公洋	ノベルクリスタルテクノロジ ー	会場
合同セッション／「インフ オマティクス応用」	19w-B01-4	B01 9/19(木) 09:45~10:00	デジタルアリーナによる資料分析	吉富 実希	会場	会場
			デジタルアリーナによる資料分析	吉富 実希	会場	会場
シンボジウム 結果シリコン太陽電池の 現状と未来	19p-B12-1	B12 9/18(木) 13:15~13:45	多結晶シリコン太陽電池における高活性シリコンイノベントの創成に向けた	宇佐美 達裕	名古屋工	会場
			多結晶シリコン太陽電池における高活性シリコンイノベントの創成に向けた	宇佐美 達裕	名古屋工	会場
シンボジウム ナノカーボン・電子荷物質 の新展開と将来展望	20p-E201-3	E201 9/20(金) 14:15~14:30	单層カーボンナノチューブの表面遮蔽性質の内因性に対する必要を見ることで識別できることが知られているが、これまでには多層のナノチューブを用いた平均的評価に限られていた。これに対し、本研究ではナノチューブ1本の表面遮蔽性質の識別に成功しており、表面遮蔽性質やナノデバイス応用に向けた重要な成果である。	ST-MATER DATA法を用いた單一カーボンナノチューブの光学活性評価	桑原 勝裕	大阪大工

今回の注目講演は18件。プログラム編集委員がおすすめする講演です。

